

축퇴 4 광파 혼합에 의한 광영상 복원과 R.H.T 의  
반사율에 관한 연구

○ 김수경, 박광철, 양인웅, 김은수  
광운대학, 전자 공학과

A Study on the Optical Image Restoration and Reflectivity of Reflection  
Hologram Type by Degenerate Four Wave Mixing

Kim Soo Kyung, Park Kwang Chul, Yang In Eung, Kim Eun Soo  
Kwang Woon University Electronic Engineering.

Abstract

Phase conjugate wavefront generation via real-time holography in degenerate four-wave mixing experiments in photo-refractive crystal  $\text{Bi}_x\text{Si}_y\text{O}_{z0}$  is presented. Depending on the respective values of applied field  $E_0$  and fringe spacing  $\Delta$ , drift or diffusion of the photocarriers dominates the space-charge buildup and affects the Phase-Conjugate Wavefront intensity.

The experimental results for wavefront reflectivity as a function of the intensity ratio of the writing beams agree with the theoretical predictions.

2. 이론

(1) 위상 공역파 발생

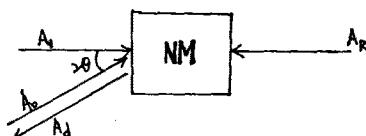


그림 1. DFWM에 의한 위상 공역파 발생

Fig. 1 Phase conjugate generation by DFWM.

본 논문의 반사형 격자 형성에서는  $A_L$ 이 기록파(전방 기준파)이고  $A_R$ 은 후방 기준파이다. 두파, 즉 기록파  $A_L$ 과 탐사파  $A_R$ 의 사이각  $2\theta$ 를 작게하는 이유는 공간주파수가 높을 때에는 확산 현상이 무드러지고, 공간주파수가 낮을 때에는 표동에 의해 반사율이 달라지게 된다. 즉, 주파수가 0이고,  $+z$ 방향으로 진행하여 위상 공역거울에 입사하는 광파의 field를  $E = \text{Re}[\Psi(x, y, z) \exp(iwt)]$ 로 나타낼 수 있다. 여기서,  $\Psi(x, y, z) = A(x, y) \exp[i(\phi(x, y) - kz)]$ 이고,  $A(x, y)$ 는 실수값이다.  $E = A(x, y) \cos(wt - kz + \phi(x, y))$ 로 표현 될 수 있다.

이제 위상 공역거울에서 반사되는 위상 공역파의 공간 성분은 입사편파의 복소공역 이므로

$$\begin{aligned} E &= \text{Re}[\Psi^*(x, y, z) \exp(iwt)] \\ &= \text{Re}[A(x, y) \exp(-i\phi(x, y) - kz) \exp(iwt)] \\ &= A(x, y) \cos(wt + kz - \phi(x, y)) \\ &= A(x, y) \cos(-wt - kz + \phi(x, y)) \end{aligned} \quad \text{---(1)}$$

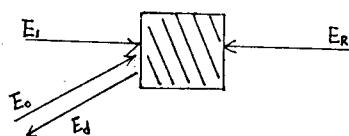


그림2. 측광4광파 혼합에 의한 반사형 격자 형성.

Fig. 2 Reflection Hologram type by DFWM.

전형적인 측광4광파 혼합을 살펴보면 그림2에서 측광4광파 혼합에 관련된 광파는 다음과 같다.

$$\text{전방 기준파 } ; E_L = 1/2 A_1 \exp[i(wt - k_1 r)] + c.c$$

$$\text{후방 기준파 } ; E_R = 1/2 A_R \exp[i(wt - k_R r)] + c.c$$

$$\text{탐사파 } ; E_o = 1/2 A_o \exp[i(wt - k_o r)] + c.c \quad (2)$$

$$\text{위상 광역파 } ; E_d = 1/2 A_d \exp[i(wt - k_d r)] + c.c$$

### (2) 위상 광역파의 반사율(Reflectivity)

매질내 총 빛의 세기는 다음과 같다.

$$I_F |A_o + A'_o + A_R|^2 \\ \approx I_i (1-R) + I_i (1-R)\beta + I_R (1-R) + 2\sqrt{R} |A_o| |\cos k_x + 2\sqrt{R} |A_R| |\cos k_x|$$

$+ A_o A_R$ 의 상호 작용으로 인한 항.

여기서  $\beta = \frac{I_o}{I_i}$ , 이며  $A_o, A'_o, A_R$ 는 매질내 세파의 진폭을 표시한다. 즉, (3)식은 세파가 서로 간섭성이 있으며  $A_o$ 과  $A_R$  사이각이 매우 작다고 가정한것으로, 마지막항은 매질내 공간 변조가 발생하지 않으므로 무시해도 된다. 전장이 가해지지 않았을 때, 반사형 격자  $K_1$ 은 투과형격자  $K_t$ 보다 더 높은 공간 주파수를 갖게 되어서,  $K_1$ 에 의한 확산이 반사율에 기여하게 된다. 즉, 반사형 홀로그램 격자  $K_1$ 가 무드러지게 나타나므로 여기서는  $K_1$ 를 더 고려해보자.

$$I_R = (1-R)^2 \exp(-\alpha d) I_i \quad (4)$$

식(3)은 다음과 같이 표시된다.

$$I'_t = I_i (1-R) + I_i (1-R)\beta + I_R (1-R) + 2 [I_i (1-R)^2] \frac{1}{4\pi^2} \cos k_x z$$

$$= I_i (1-R) [1 + \beta + (1-R)^2 \exp(-\alpha d)] (1 + M \cos k_x z) \quad (5)$$

여기서,  $\alpha$ 는 흡수계수이고,  $M$ 은  $K_1$ 의 변조도 이므로

$$M = 2\sqrt{\beta} (1-R) \exp(-\alpha d/2) * [1 + \beta + (1-R)^2 \exp(-\alpha d)]^{-1} \quad (6)$$

그림1에서 기록파  $A_1$ 은 회절된파로 인해 반사형 격자  $K_1$ 에 의해 회절된다.

$$I_d = \eta'_r I_i (1-R)^2 \quad (7)$$

( $\eta'_r$ 는 위상격자의 회절효율 상수이다.)

그러므로 위상 광역파의 반사율은

$$\eta_r' = I_d / I_o = R_g I_d / I_o = R_g (1-R)^2 \eta'_r / \beta \quad (8)$$

여기서  $R_g$ 는  $BS_1$ 을 통한 반사도이다. 즉 위상 광역파의 반사율은  $\eta_r' = I_d / I_o$ 로 정의되며, 특히 외부 전장의 세기와 비례하여, 간섭무늬 간격에 따라 특이한 현상을 나타낸다.

$$\text{먼저, } \begin{cases} E_T = 2\pi/q(kT/\lambda) = A\lambda^{-1}, A = 2\pi/q(kT) \\ E_q = 2q/k_e q(N/\lambda) = B\lambda, B = 2q/k_e q(N) \end{cases} \quad (9)$$

$E_T$ : 전하확산에 의해 형성된 전장  
 $E_q$ : 공간 체적 전하에 의해 형성된 최대전장

즉, 결정내에 형성되는 전장 유무시 위상 광역파의 반사 효율은 다음과 같다.

1)  $E_q = 0$  kV : 확산의 경우

$$\eta_r' = R \cdot A \lambda^2 (1 + (A/B) \lambda^2)^{-1} \cdot 4n^2 \lambda^4 / (4n^2 \lambda^4 - \lambda^2) \quad (10)$$

간섭무늬 간격  $\lambda > 1\mu$  ( $E_q > E_T$ ) 일때, 반사율  $\eta_r'$ 은  $\lambda^2$ 에 비례하며,  $\lambda = 0.5\mu$ 에서는 포화 상태가 된다. ( $E_q \approx E_T$ )

(1)  $E=0 \text{ kV/cm}$ : 표등에 의한 경우

$$\eta_q = R \frac{E_0^2 + E_q^2}{(1+E_0^2/E_q^2 + E_0^2/E_q^2)} \frac{4\pi^2 \Lambda^2}{4\pi^2 \Lambda^2 - \Lambda^2} \quad \text{---(11)}$$

$\Lambda > 3 \mu\text{m}$ ;  $E_q \ll E_0$  이므로  $E_q$  무시 한다. 그러므로

$$\eta_q = R \frac{E_0^2}{1 + E_0^2/E_q^2} \frac{4\pi^2 \Lambda^2}{4\pi^2 \Lambda^2 - \Lambda^2} \quad \text{---(12)}$$

즉,  $\Lambda$ 와  $E_0$ 가 증가 할수록 반사 효율도 증가한다.

### 3. 실험 및 결과고찰

#### (1) 실험 방법 및 회절 효율 측정

그림3과 같이 왜곡 보상 실험을 위해서, 간섭 무늬 간격  $\Lambda$ 과 일사되는 세포의 세기 및 외부 전장  $E_0$ 를 변화 시켜서 최대 회절 효율을 측정하였다.

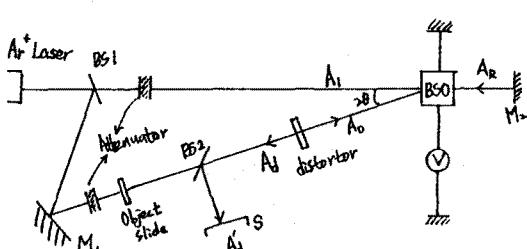


그림3. 광영상 복원 및 회절효율 측정 구성도

Fig.3. Optical Image Restoration and diffraction efficiency measurement set-up.

이때 파장이 514.5nm인 Ar+ Laser를 이용하여 세광의 간섭 거리는 2cm내로 조정하였으며 전방 기준파와 탐사파 사이각은 약 11.9°로 고정하여 각파의 세기는 각각 9.2mw/cm²와 3.9mw/cm²로 실험하였다.(광감세기 사용)

#### (2) 결과

광의 세기비는 식(9)에서의  $B=0.7 \times 10^3 \text{ V/cm}^2$  상대가 가장 좋으며  $I_1 > 10I_0$  일 때 반사를 온 포화 상태가 된다.(그림5)

매질의 세파의 강도 흡수 계수  $a=2.1 \text{ cm}^{-1}$ 이며 특히, 전장 을 가해줄 때 주의할점은 양전극 간의 면적에 고루 분포 시켜서 큰 공간 전하 전장 발생을 피해야 한다. 그렇지 않으면, 결정 끝 부분은 조명되지 않으므로 활용비가 증가하게 되기 때문이다. 결국 반사형 홀로그램은 광활성도가 높고, 안정하며, 가간섭 거리가 짧고, 광경로차가 최소로 되어야 높은 반사를 올 수 있다.

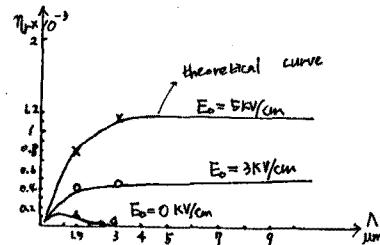


그림4.  $\Lambda$ 에 따른 외부전장  $E_0$ 에 대한 위상 공역과 회절 반사율 ( $x, \circ, \Delta$ ; 실험치)

Fig.4 Reflectivity versus fringe spacing

for different values of applied field  $E_0$ .  
( $x, \circ, \Delta$ ; experimental points)

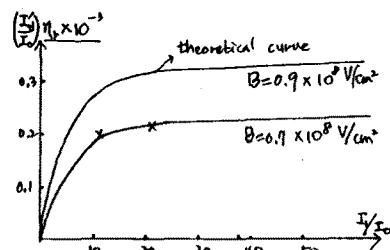


그림5.  $I_0/I_0$ 과  $I_0/I_0$ 의 관계 Fig.5 Relationship of reflectivity  $I_0/I_0$  with reading-to-object beam ratio  $I_0/I_0$ . (crystal thickness:  $l=10\text{mm}$ ,  $\Lambda=0.259\mu\text{m}$  x; experimental points)

### 4. 결론

비 선형 매질 BSO를 사용하여 부과형 홀로그램이 아닌 반사형 홀로그램으로 발생된 위상 공역과 회절 효율을 측정하였으며, 공간 주파수를 높게 하였을 경우 생기는 격자간의 간격이 좁아 지므로 반사형 홀로그램의 효율을 상당히 높일 수 있었고, 2차원 광영상 왜곡을 보상하였으며, 이때 기존의 부과형 홀로그램의 경우 못지않은 반사 효율을 얻을 수 있었다.

(참고 문헌)

- 1) J. P. Huignard, J. P. Herriau, P. Aubourg and E. Spitz,  
Optics Lett. (1979) 21.
- 2) M. Peltier and F. Micheron, J. Appl. Phys. 48(1977)  
3683
- 3) H. Kogelnik, Bell Syst. Techn. J 48(1969) 2909
- 4) Y. H. Ja, Elec. Lett. 17(1981) 488
- 5) 혀 세현, BSO 단결정 을 이용한 광위상 광액파  
발생 과 광영상 복원에 관한 연구. (전자 공학회  
학술 발표 논문집 Vol. 9, No. 1 (1986) 555 )